

本期封面



2003年2期

栏目:

DOI:

论文题目: MoSi₂高温氧化层的微观结构

作者姓名: 常春, 李木森, 陈传中, 田雷言

工作单位: 山东大学材料科学与工程学院, 济南 250061

通信作者: 常春

通信作者Email: changchun@sud.edu.cn

文章摘要: 采用SEM, TEM和XRD方法研究了MoSi₂在1200-1600℃的氧化层微观结构. 在1240℃以下, 氧化层由SiO₂和其它氧化物混合而成, 致密度较差. 1240-1520℃区间氧化层表面存在针状、扇状或羽状的低温石英, 氧化层较薄. 在1520℃以上, 氧化层中含有块状、粒状或蜂巢状的方石英, 氧化层致密而均匀, 增强了材料的抗氧化性能.

关键词: MoSi₂, 微观结构, 氧化层

分类号: TG111

关闭